

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : STUDI PENGARUH PLASMA ETCHING GAS  $CH_2FCF_3$  PADA PERMUKAAN  $SiO_2$  TERHADAP PERUBAHAN KEKASARAN PERMUKAAN  $SiO_2$

Penulis Jurnal Ilmiah : 1. Antonius Prisma Jalu Permana, S.Si., M.Si.

Status Penulis : ~~Mandiri~~ / Utama / ~~Anggota~~

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal WAWASAN UKWK  
b. Nomor / Volume : ISSN: 0854-4948 Volume XXVI No.1  
c. Edisi (bulan/tahun) : November 2017  
d. Penerbit : Universitas Katolik Widya Karya Malang  
e. Jumlah halaman : 39 halaman  
f. Alamat web Jurnal : <http://lppm.widyakarya.ac.id/wawasan-volume-xxvi-1-antonius-prisma-jalu-permana/>  
g. Terindeks di : <https://scholar.google.co.id>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :  Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)			7.0	0.7
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			7.5	2.25
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			7.2	2.16
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			7.0	2.1
<b>Total = (100%)</b>				<b>7.21</b>

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

Diusahakan agar jurnal bisa diakreditasi.

Malang, 19 September 2018  
Reviewer 1,



**Ir. D. J. Djoko HS, MPhil. Ph.D.**  
**NIP. 19660131.199002.1.001**

Unit Kerja : Jurusan Fisika  
Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Brawijaya  
Malang

Jabatan Terakhir : Asisten Ahli  
Bidang Ilmu : Fisika Material

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : STUDI PENGARUH PLASMA ETCHING GAS  $CH_2FCF_3$  PADA PERMUKAAN  $SiO_2$  TERHADAP PERUBAHAN KEKASARAN PERMUKAAN  $SiO_2$

Penulis Jurnal Ilmiah : 1. Antonius Prisma Jalu Permana, S.Si., M.Si.

Status Penulis : ~~Mandiri~~/ Utama / ~~Anggota~~

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal WAWASAN UKWK  
 b. Nomor/Volume : ISSN: 0854-4948 Volume XXVI No.1  
 c. Edisi (bulan/tahun) : November 2017  
 d. Penerbit : Universitas Katolik Widya Karya Malang  
 e. Jumlah halaman : 39 halaman  
 f. Alamat web Jurnal :  
<http://lppm.widyakarya.ac.id/wawasan-volume-xxvi-1-antonius-prisma-jalu-permana/>  
 g. Terindeks di : <https://scholar.google.co.id>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :

Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)			2,3	0,73
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			2,6	2,28
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			2,3	2,19
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			2,0	2,1
<b>Total = (100%)</b>				<b>2,3</b>

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

perlu dibahas lebih detail ttg hubungan flow rate thd etching process

Malang, 19 September 2018  
 Reviewer 2,

  
**Dr. Eng. Masruroh, S.Si., M.Si.**

**NIP. 19751231.200212.2.002**

Unit Kerja : Jurusan Fisika

Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam  
 Universitas Brawijaya  
 Malang

Jabatan Terakhir : Lektor

Bidang Ilmu : Fisika Material